走查型透過電子顕微鏡

(STEM)

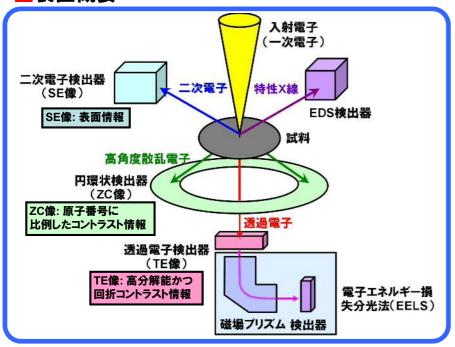


STEM[ステム] : Scanning Transmission Electron Microscope

■原理 EELS[イールス]: Electron Energy-Loss Spectroscopy

薄片化した試料に電子を照射し、試料中を透過もしくは試料により散乱した電子を利用して、観察・分析を実施する。

■装置概要



■分析できない材料

揮発性材料・磁化を帯びた材料

■サンプル制限

直径3mmφ以内、厚み0.5mm以内

■観察可能箇所

マイクロサンプリングした薄片 縦 x 横 x 厚み: 8µm x 5µm x 100nm前後 微粉末 ミクロトーム切片

■特徴

- 空間分解能0.204nmにより、nmオーダーの測長や微小領域(2nm程)の分析が可能。
- ホルダーリンケージにより、FIB装置間の移動が可能。
- 360度回転ホルダーによりデータ取得および三次元再構築することで、 多様な方向から立体構造の観察が可能(トモグラフィー解析)。
- 雰囲気遮断試料ホルダーを用いて、水分・酸素・窒素脆弱材料の解析が可能。
- EDXにより、元素(B~U)の同時定性分析や半定量値を算出することが可能。
- EELSにより、軽元素(Liなど)分析や化学結合状態の解析が可能。

アプリケーション

像観察:二次電子像(SE)·散乱電子像(ZC)·透過電子像(TE)·電子回折図形

三次元再構築:トモグラフィー解析 EDX:点分析・線分析・元素マッピング EELS:点分析・線分析・元素マッピング

■分析事例

IC・メモリなどの微細構造解析 Li電池の軽元素分析

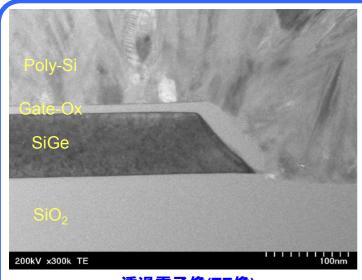
■分析の際に必要な情報

断面構造および着目箇所 構成元素、予想される化学組成情報

走査型透過電子顕微鏡/エネルギー分散型X線分析

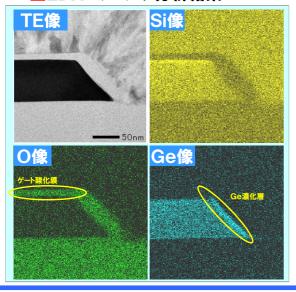
(STEM/EDX)

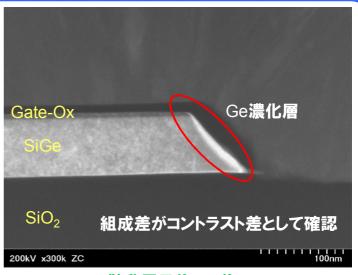
■観察事例(MOSデバイス 断面解析)



透過電子像(TE像)

■EDXマッピング分析結果





散乱電子像(ZC像)

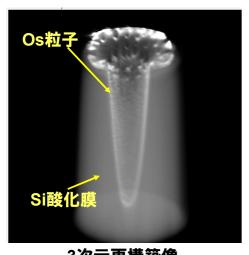
■観察モードの特徴

TE像:Transmission Electron Image 結晶粒・結晶欠陥の観察に適する。 重い物質が存在する箇所は、透過能が 低下するため、コントラストが低下する。

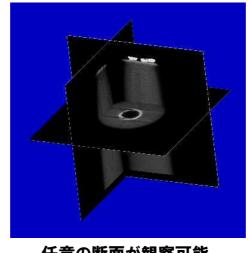
ZC像:Z Contrast Image 試料の組成に応じたコントラスト、つまり 重たい元素・物質ほど明るく観察され、 そのコントラストは原子番号の2乗に 比例すると言われている。

EDXマッピング像:Energy Dispersive X-ray Spectrometry 電子線を照射した際に励起される特性X線を エネルギー値で分光・検出することにより、 照射領域の構成元素を定性・定量する分析手法。 点分析. ライン分析および面分析が可能。

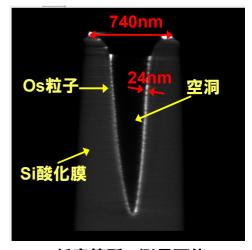
|分析事例(トモグラフィー解析事例:ホール側壁の微粒子)



3次元再構築像



任意の断面が観察可能

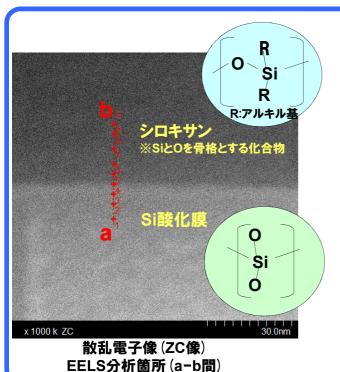


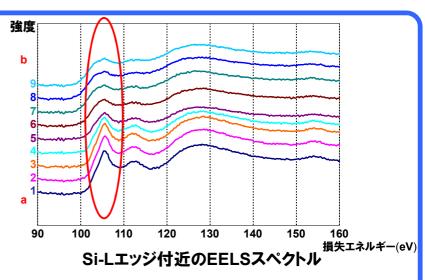
任意箇所の測長可能

走査型透過電子顕微鏡/電子エネルギー損失分光法 1115

(STEM/EELS)

■分析事例(EELSスペクトル解析事例)

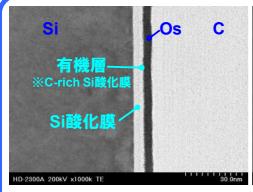


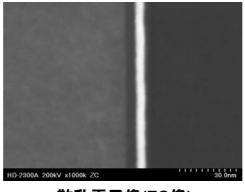


EDXでは、各構成元素「Si」と「O」の情報のみである。 EELSスペクトルでは、

構造の違いに起因するピークの変化が確認できる。

|観察事例(EELS マッピング解析事例)

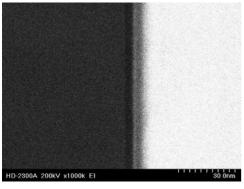


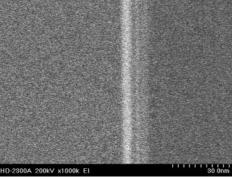


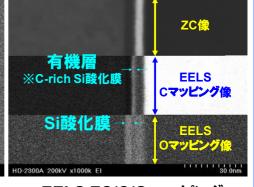
TE像とZC像では、 Si酸化膜と有機層の違いを 確認できない。

透過電子像(TE像)

散乱電子像(ZC像)







EELS C-マッピング

EELS O-マッピング

EELS ZC/C/O-マッピング

EELS 元素マッピングは、1分以内でデータ取得可能である。また、観察中に元素マッピングへ信号を 切り替えることができ、有機層とSi酸化膜の違いが鮮明に確認できる。